

経済産業大臣

宮 沢 洋 一 殿

一般社団法人日本半導体製造装置協会

会 長 牛 田 一 雄

税制改正に関する要望書

わが国経済は、2年半前の安倍政権発足以来、「金融政策」「財政政策」「成長戦略」を柱とするアベノミクスの推進により、行き過ぎた円高の是正、企業収益や消費マインドが改善され、緩やかながら回復基調を継続しております。こうしたなか、今後とも景気回復を持続させ、日本経済を持続的な成長軌道に乗せる為には、国内に立地する日本企業がグローバルな競争に勝ち抜き、経済成長を推し進める事が重要であります。

近年、日本の製造業はいわゆる六重苦^{*1}と言われるビジネス環境の中、海外企業と熾烈な競争を戦ってきました。しかし、円高の改善はみられるものの、法人税率、研究開発促進税制等は諸外国とはまだまだ格差が大きく、電力コストも含め非常に厳しいビジネス環境にあります。我が国の製造業が熾烈なグローバル競争に打ち勝ち、更なる発展に繋げるには、税制面でのイコルフッティングの環境が極めて重要であります。

昨年アベノミクスの成長戦略として「ロボット新戦略」が策定されました。更に本年『「日本再興戦略」改訂2015』では、鍵となる成長戦略として、IoT・ビッグデータ・人工知能による産業構造変革、いわゆる「第四次産業革命」が取り上げられました。この成長戦略を実現するにはIT・エレクトロニクス産業のイノベーションの創出が必要不可欠です。日本の半導体・液晶パネル製造装置産業は、このIT・エレクトロニクス産業を支える基盤産業であり、世界シェア4割弱と大きなシェアを有しております。また、半導体・液晶パネル業界は技術進歩が著しい産業であり、絶えず最先端技術の研究・開発を促進することは、日本企業がグローバル競争に打ち勝つ為には必要不可欠です。当業界では、これまでも比類のない装置性能の向上に多大な研究開発投資を継続してきました。これを裏付けるように半導体・液晶パネル製造装置産業の売上高研究開発費率は約9.1%^{*2}と、製造業平均の4.617%^{*3}、全産業平均の3.53%^{*3}の約2~3倍と非常に高くなっています。

このような研究開発活動を促進させ、イノベーションを創出し、グローバル競争を勝ち抜く為には、税制面での整備・支援によるビジネス環境のイコルフッティングが不可欠です。

現政権の成長戦略を更に推進するため、次に掲げる税制の整備を昨年、一昨年同様に強く要望します。

*1 円高、高い法人税、経済連携協定の遅れ、柔軟性に欠ける労働市場、環境規制、電力供給不足・コスト増

*2 当協会の2015年8月調査によるSEAJ会員企業主要15社の2010~2014年度の5年間の平均

*3 出所：経済産業省「平成26年度企業活動基本調査」

1. 研究開発促進税制の拡充と見直し

既に述べたとおり、半導体・液晶パネル製造装置産業の売上高研究開発費率は9.1%^{※2}と、国内他産業と比較して約2~3倍もの研究開発費を投じています。海外競合企業の売上高研究開発費率も15.8%^{※4}となっており研究開発費比率が非常に高い産業と言えます。

半導体・液晶パネル製造装置産業が支える、半導体及び液晶パネル、それらを用いたIT・エレクトロニクス産業は製造業のGDPの40%以上を占める^{※5}巨大な産業であり、日本の他産業の発展にも大きな影響を及ぼしています。

当産業の研究開発費は、半導体や液晶パネルのさらなる微細化・高精細化、ウエハやプレート基板の大型化等のニーズに応えるために一層巨額となってゆく傾向にあります。こうした状況下においても、当産業が必要十分な研究開発費を投じて成長し、同時に他産業の発展を促進してゆくことは、わが国が注力すべき次の課題に照らしても必須と考えます。

①次世代自動車、次世代交通システム、IT機器、次世代デバイス等の最先端の製品の競争力向上

②低消費電力化やスマートグリッド等によるグリーン・イノベーションの推進

③先進的医療機器・サービスによる国民の健康寿命の延伸と医療費抑制

④センサー、ロボット、ビッグデータ等のITを利用した安全・便利な生活環境

⑤国民・社会を守る世界最高水準の通信インフラの整備

⑥イノベーション・ベンチャーの創出による技術立国・知財立国日本の再興

こうした当産業における研究開発費の状況とその果たす役割を踏まえて、次の措置を要望します。

※4 当協会の2015年8月調査による海外競合企業主要5社の2010~2014年度の5年間の平均

※5 半導体産業研究所「半導体産業が日本の社会・経済・環境に与えるイパ[®]外の社会科学分析」2009年7月

(1) 試験研究費の税額控除割合の拡大及び税額控除限度額の廃止

当産業の研究開発費が多額であること、それによってもたらされる産業全体の成長とイノベーションが国益にもたらす影響を踏まえ、現在の試験研究費の総額に係る税額控除制度における税額控除割合（平成27年度：試験研究費の8~10%が限度）の拡大と、控除限度額（平成27年度は25%に引き上げられ、新設のオープンイノベーション型(5%)を含め法人税額の30%に拡大）の廃止を要望します。

尚、当産業の税額控除限度額の切捨て額は214億円^{※6}と大きな額となっており、これは当産業の法人税額827億円^{※6}の約26%相当額となります。

※6 当協会の2015年8月調査によるSEAJ会員企業主要15社の2010~2014年度の5年間の平均

(2) 繰越税額控除限度超過額等の繰越期間の復活及び繰越税額控除要件の廃止

当産業の業績は、顧客である半導体・液晶パネルメーカーの急激な投資動向の変化による振れ幅が大きく、かつそのサイクルも長期にわたるケースが多くあります。そうした特徴から、現在、試験研究費について繰越税額控除限度超過額がある場合、繰越控除が1年間に限ってのみ認められていましたが平成27年度より

本制度が廃止されました。また、廃止前の制度でさえ当該事業年度に所得がないために本制度による恩恵を受けられないケースが生じていました。

従って、まずは本制度の復活を要望するとともに、諸外国の同制度が主に3年～無期限であることに鑑み、繰越税額控除限度超過額等の繰越期間を無期限とし、併せて繰越税額控除限度超過額の繰越控除を行う際の「当事業年度の試験研究費の額が前事業年度を上回る場合に限る」という要件を廃止することを要望します。

尚、当産業の繰越税額控除限度超過額の切捨て額は160億円^{※6}と大きな額となっております。

※6 当協会の2015年8月調査によるSEAJ会員企業主要15社の2010～2014年度の5年間の平均

(3) イノベーションボックス税制の創設

研究開発の成果である特許などの知的財産に基づく所得を減税対象とするイノベーションボックス税制が欧州を中心に普及し始めています。

既にEUにおいては、英国、オランダ、フランス等7カ国が、アジアにおいては中国がイノベーションの促進及び競争力向上を目的として、研究開発の成果である知的財産権から生じる所得に対する税率を優遇するイノベーションボックスまたはパテントボックス税制を導入しています。

一例として本税制を積極的に導入・推進するオランダでは、2004年に29.0%であった法人税率を2011年までに段階的に25.0%に引き下げる措置と併せて、2010年に従来のパテントボックス税制をイノベーションボックス税制へと拡大しています。これにより、研究開発活動による知的財産から生じた所得については法人税の計算上5%の軽減税率の適用を選択することを可能としています。

オランダに本社を置く半導体露光装置の世界最大手であるASML社の2010年度から2014年度の法人税率は平均7.8%と極めて低く^{※7}、イノベーションボックス税制の恩恵を最大限受けております。

海外企業と同じビジネス環境で熾烈な競争を戦えるよう、わが国においてもイノベーションボックス税制をできる限り早期に導入することを要望します。

※7 ASML社決算報告書による2010～2014年度の5年間の平均

2. 法人実効税率の引下げ

わが国の法人実効税率は、平成24年度から段階的に40.69%⇒38.01%⇒35.64%⇒33.10%へ引き下げられましたが^{※8}、依然として欧州及びアジア諸国に比べて高い水準にあります。同程度の水準である米国においても、オバマ大統領が法人税の最高税率を35%から28%に、製造業については25%にする法人税改革を表明しています。

特にわが国と事業及び立地において競争関係にあるアジア諸国と比較すると、中国25%、韓国24.2%、シンガポール及び台湾17%と10%以上の乖離があり、日本の企業競争力及び立地競争力低下の大きな要因になっており、世界で戦う日本企業が継続的に存続することは困難です。

立地競争力強化のためには、空港・港湾等の産業インフラの整備、金融・資本市場の活性化、雇用制度の改革、人材強化等の総合的な施策が必要ですが、法人実効税率の引き下げの果たす役割は特に重要です。

従って、現在懸念されている「根こそぎ空洞化」を防止するに留まらず、より積極的に海外の成長力ある企業がわが国を拠点とした事業活動を行うことを希求する水準への思い切った引き下げが必要です。

具体的には、法人実効税率をアジア諸国と競争力のある水準である 20%前半まで、3 年以内に引き下げることがを要望します。

※8 東京都の大法人的場合、平成 28 年 4 月 1 日以降開始事業年度は 32.34%になる予定

3. 欠損金の繰越控除限度額及び繰越期間の見直し

平成 24 年度から中小法人等以外の法人については欠損金の繰越控除が欠損金控除前課税所得の 80%に制限され、併せて欠損金の繰越期間が 7 年から 9 年へと延長されました。

更に平成 27 年度税制改正では、繰越期間が 10 年に延長されるものの、繰越控除限度額が平成 27 年度及び平成 28 年度では 65%に、平成 29 年度以降では 50%に制限されることに改正されました。

先に述べたように当産業は、顧客である半導体・液晶パネルメーカーの投資動向による業績の振幅が大きく、かつその回復までのサイクルが長期にわたるケースが多いため、現在の繰越欠損金の取り扱いでは不十分なケースも見受けられます。

また、わが国の欠損金に関する制度は、諸外国に比べて見劣りのするものであり、さらに、先の平成 27 年度税制改正を経てその差は拡大している状況で、とりわけ当産業において苦境にありながらも業績回復に注力する企業にとって障害となっています。

諸外国に比べ不利な条件である繰越控除額の制限を廃止すると共に、繰越期間を無期限とするよう要望します。

4. 設備投資に関する減税及び資産課税制度の見直し

(1) 設備投資に関する減税

当産業では、半導体・液晶パネルの微細化やウエハ・基板の大型化に対応するために多額かつ継続的な設備投資が必要であり、また、当産業の顧客である半導体及び液晶パネルメーカーも、より付加価値の高いデバイスを製造していくための設備投資が不可欠なものとなっています。

海外企業との熾烈な競争の中にある国内の半導体・液晶パネル製造装置産業、半導体・液晶パネル産業および半導体関連電子製品産業が、世界最高レベルの技術水準を維持し、かつグリーン・イノベーションの推進にも貢献していくために、生産性向上設備投資促進税制など、設備投資の目的に配慮した減税の拡充と期限延長を要望します。

(2) 固定資産税（償却資産）の見直し

同様の趣旨から、わが国の償却資産に関わる固定資産税が国際的に見ても希な制度（特に当業界にとって競争が著しい韓国、中国には当制度は存在しない）であることを踏まえ、その速やかな縮減・廃止を要望します。

5. 国際関連税制の見直し

(1) 二国間租税条約の締結推進

企業活動がますますグローバルに展開される中で、二重課税のリスクを排除すると共に経済連携を強化するためには、租税条約のネットワークを整備することは極めて重要です。

そうした中で、近年わが国も租税条約の締結を積極的に進めていますが、台湾については半導体及び液晶パネルの世界の生産拠点であり本業界の主要な輸出先であると共に、日本の相手国としても第4位^{※9}の重要な地位を占めるにも関わらず、二国間租税条約が締結されていません。

こうした状況は当産業が同国において事業活動を行う上で、常に多額の二重課税のリスクを抱えてゆくことを意味し、かつ欧州諸国等の既に二国間租税条約を締結している国の企業との競争を阻害するものです。

わが国の租税条約ネットワークを引き続き整備すると共に、最重点課題として、台湾と早期に租税条約を締結することを要望します。

※9 2014年JETRO調査による

(2) 移転価格税制の改善

移転価格税制については、企業の予見可能性を十分確保すると共に、国際的な二重課税の早期解決のための事前相談、事前確認制度、相互協議の迅速化・効率化を図ることを要望します。

また、執行面で不透明感のある無形資産の取り扱い等において、企業活動の実態を考慮した検討と改善を要望します。

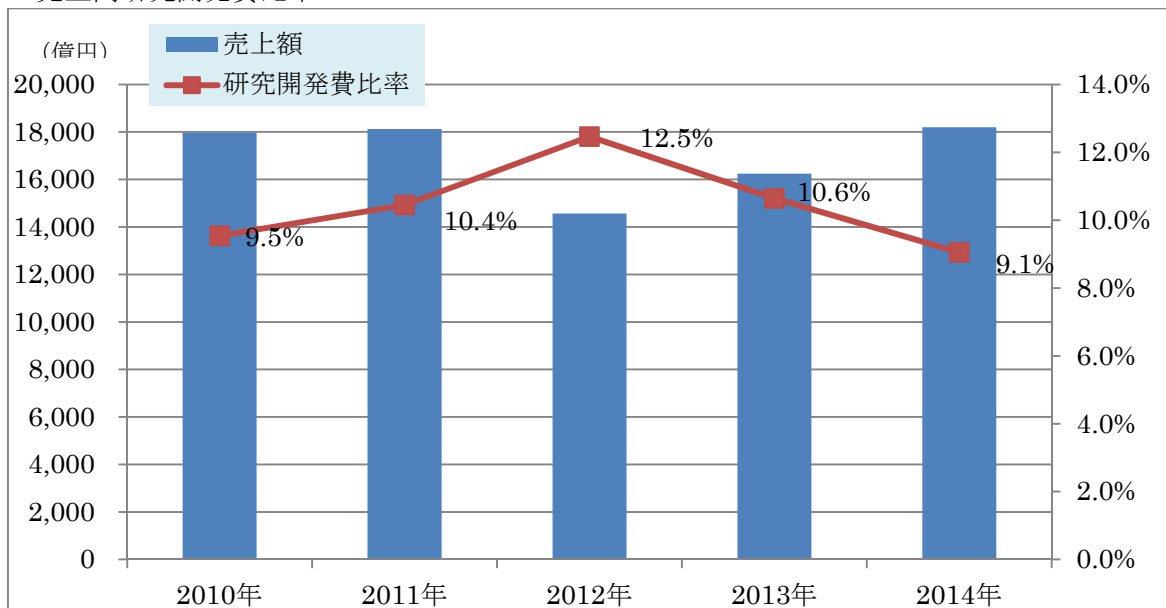
以 上

< 添付資料 1 >

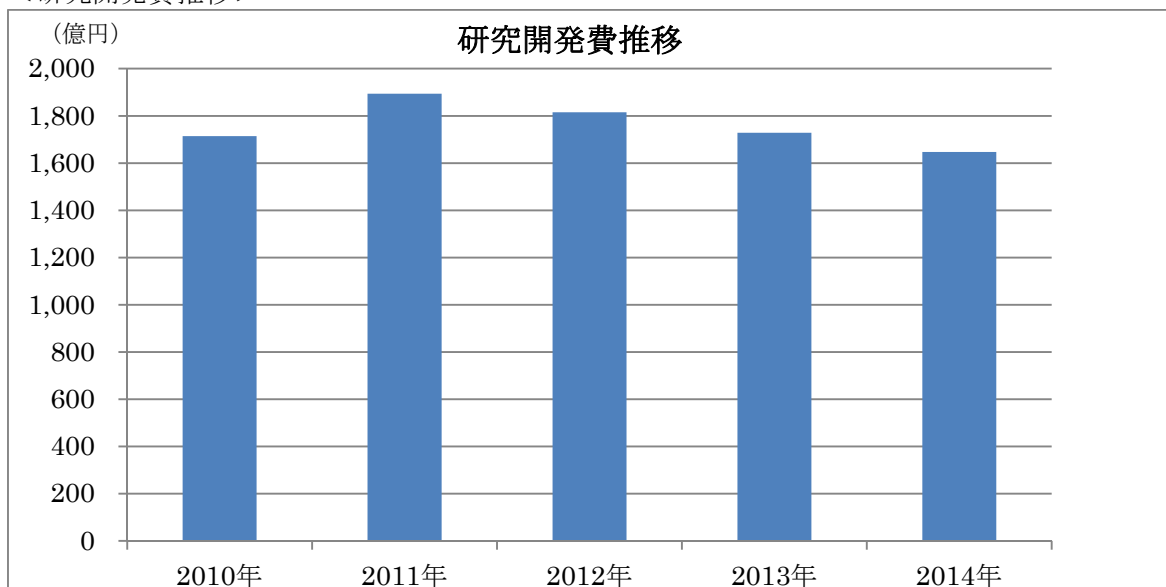
1. 売上高研究開発費及び、設備投資比率

1) SEAJ 会員企業 (主要 15 社合計)

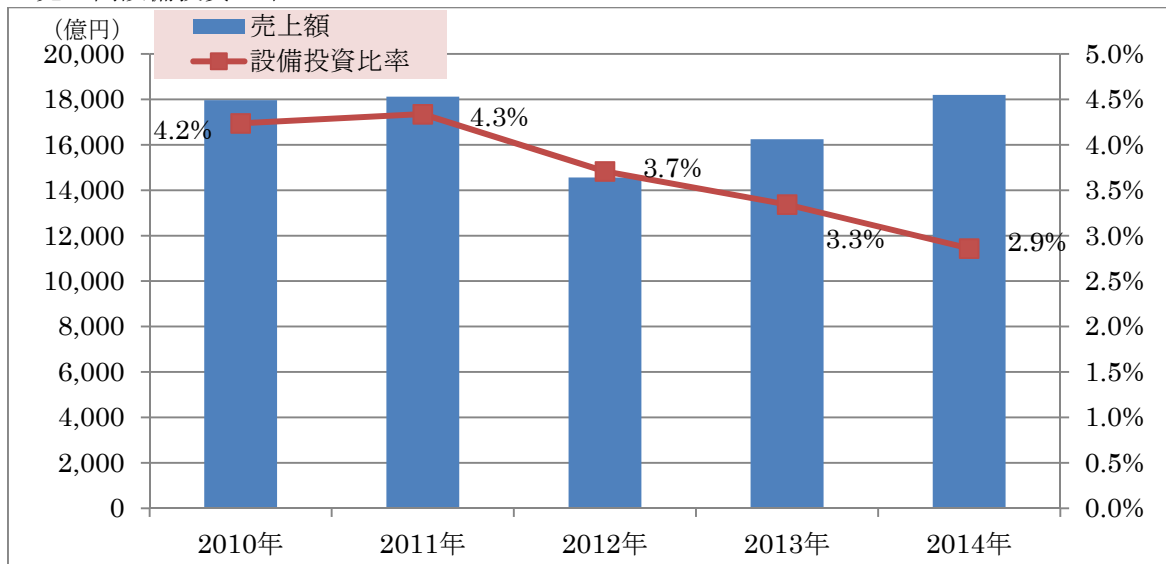
< 売上高研究開発費比率 >



< 研究開発費推移 >



< 売上高設備投資比率 >



2) 控除税枠切捨て額、繰越切捨て額 (SEAJ 会員企業主要 15 社合計)

(M¥)

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
売上額(全社)	7,179,816	6,991,005	6,545,879	6,977,020	7,127,058
研究開発費(会計上)	538,781	556,208	543,794	544,798	540,171
研究開発費(税務上)	527,855	460,591	459,010	460,503	453,214
法人税額	84,280	76,083	73,266	90,405	89,448
控除税額	24,952	21,747	20,787	25,417	24,121
税枠切捨て額	25,175	22,274	21,171	21,500	17,000
繰越切捨て額	10,094	14,939	26,691	17,265	11,104
増加型の適用「有」	5	2	2	5	5
増加型の適用「無」	4	7	10	9	9

(注) 上記表に記載されている税務上の研究開発費、法人税額など税務上に関わる数値は法人税の別表を基に記載してあります。

3) 日本主要産業別研究開発費

(出所：経済産業省「平成 26 年度企業活動基本調査 (平成 25 年度実績)」)

	研究開発費 報告企業数	売上高 (億円)	研究開発費 (億u円)	受託研究費 (億円)	売上高研究 開発費比率 (%)	1企業当たり(百万円)	
						売上高	研究開発費
合計	8,344	3,548,612	125,299	10,837	3.53	42,528.9	1,501.7
製造業	6,327	2,478,915	114,296	3,294	4.61	39,179.9	1,806.5
電気・ガス業	34	238,271	1,063	149	0.45	700,798.1	3,125.8
情報通信業	530	114,152	2,690	435	2.36	21,538.2	507.5
卸売業	959	608,018	5,623	323	0.92	63,401.2	586.3
小売業	122	32,724	111	2	0.34	26,823.1	90.9
サービス業(*)	119	21,875	174	11	0.80	18,382.7	146.2